

2021年8月24日

各位

**基盤技術研究所・研究員が 2021 年度高分子学会のフェロー表彰者に決定
-高分子計算機科学の発展と普及に大きな貢献-**

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン株式会社（社長：田中 公章）の基盤技術研究所に所属する 本田 隆が、公益社団法人高分子学会より 2021 年度フェローの称号を授与されました。これは、平均場法を中心とした計算手法の開発と高分子化学への貢献が評価されたものです。なお現職の当社研究員が高分子学会フェローの称号を授与されたのは、今回が初めてとなります。

高分子学会は、会員数 10,000 を超える学術団体であり、高分子に関する科学及び技術の基礎的研究及びその実際の応用の進歩、学術文化の発展並びにそれらを担う人材の育成を図ることを目的として設立された公益社団法人です。当社も会員企業であり、なかでも高分子学会が発行する Polymer Journal において、優れた論文を発表した若手研究者を対象に Polymer Journal 論文賞-日本ゼオン賞を創設するなど、研究奨励にも力を入れて取り組んでいます。同学会フェローは 2007 年に創設され、高分子科学・技術の発展に業績をあげ、今後も貢献が期待できる高分子学会正会員に対し、贈られるものです。

本田研究員は、当社に所属しながら国家プロジェクトに参画し、高分子系のシミュレーション手法の 1 つである平均場法（高分子の密度汎関数理論）における SCF(Self-Consistent Field)法のプログラム・SUSHI(Simulation Utilities for Soft and Hard Interfaces)を開発し、多くの研究成果を挙げました。また、各成果はソフトウェア機能として容易に使える形で公開されており、SUSHI および平均場法は国内外の研究機関や企業の研究者によって現在も広く使われております。

また昨今では、機械学習などのデータサイエンスとシミュレーションの融合分野でも実績を残すなど、計算機を用いた先駆的な研究を継続していることからその功績が認められました。

当社では今後も素材メーカーとして、社会にとってなくてはならない製品・サービスを提供するとともに、ものづくりの根幹を支える基盤技術の開発を通じて、社会に貢献して参ります。

以上

本件に関するお問い合わせ先

日本ゼオン株式会社 コーポレートサステナビリティ統括部門 広報室

電話：03-3216-2747